

2021年度 製造中核人材育成セミナー(リモート版)日程

1日目		2日目		3日目		4日目	
リモートセミナー	(プロセス)	リモートセミナー	(プロセス)	リモートセミナー	(プロセス)	リモートセミナー	(プロセス)
9:00			40. p-ch S/Dフォトリソ				52. 配線フォトリソ
	予備時間						
10:00	開会あいさつ	10	Module 3 41. pch S/Dインブラ	10	Module 5 46. コンタクトフォトリソ 47. 酸化膜エッチング (RIE)	10	Module 7: 52. 配線フォトリソ 53. Alエッチング 54. フォトレジスト除去 55. シンタリング
	オリエンテーション		ユーティリティ見学		46. コンタクトフォトリソ		53. Alエッチング
	Module1 34. ゲートフォトリソ	11	Lecture 2 LSI製造装置 (真空装置を中心に)	11	47. 酸化膜エッチング (RIE)	11	54. フォトレジスト除去
11:00			42. フォトレジスト除去		48. HFエッチング 49. フォトレジスト除去		55. シンタリング
12:00		12		12		12	
	予備時間						
13:00		13	43. RCA洗浄	13		13	
	Module 2 : 35. Poly-Siエッチング 36. フォトレジスト除去	14	Module 4 43. RCA洗浄 44. S/D活性化熱処理 45. 酸化膜堆積	14	Module 6 50. HF洗浄 51. Al堆積 CMS館内見学	14	Module 8 : ダイシング・ワイヤーボンダー実習 測定実習 ・ p-ch, n-ch単体MOSトランジスタ ・ インバータ ・ リングオシレータ
14:00			44. S/D活性化熱処理		50. HF洗浄		
			45. 酸化膜堆積		51. Al堆積		
15:00	Lecture 1 LSI作製プロセス概略 (準備ウエハの説明)	15		15		15	閉会あいさつ
16:00		16		16		16	
	37. n-ch S/Dフォトリソ 38. n-ch S/Dインブラ 39. フォトレジスト除去						
17:00		17		17		17	
	予備時間						